



鈴木 基寬

高輝度光科学研究センター*

Performance of Diamond X-ray Phase Retarder at SPring-8 Beamline BL39XU

Motohiro SUZUKI

Japan Synchrotron Radiation Research Institute

This paper reports the performance of diamond X-ray phase retarders used at beamline BL39XU of SPring-8. This undulator beamline is dedicated to hard X-ray spectroscopic applications requiring control of the X-ray polarization state. Linear polarization measurements show both the extremely high polarization rate of the undulator source, and the polarization tunability of the phase retarder. A helicity-modulation technique has been developed by combining fast helicity switching (40 Hz) using the phase retarder and phase-sensitive (lock-in) detection. The measured spectrum of X-ray magnetic circular dichroism at the Fe K-absorption edge demonstrates the efficiency of this new technique.

1. はじめに

SPring-8 BL39XU 生体分析ビームラインでは、ダイヤ モンド単結晶を用いた X 線透過型移相子^{1,2)}による X 線の 偏光状態の制御が行われている。第3世代光源のアンジ ュレータービームラインにおける移相子の性能を最大限に 生かした利用と, 共同利用実験における移相子の使い勝手 の向上を目指している。BL39XU での移相子システムの 特長として以下のものが挙げられる。(1)平行度の高いアン ジュレーター光に対して透過型移相子を用いているため、 偏光状態の変換を効率よく行える。(2)スペクトル測定の際 には, アンジュレーターギャップ, モノクロメーター, そ して移相子の角度が連係制御され,各エネルギーで X線 強度, 偏光度ともに最適化される。(3)X線磁気円偏光二 色性(XMCD)の実験に偏光変調法を用いている。従来 の磁場反転による方法と比較して、格段に統計精度の高い XMCD スペクトルを短時間で得ることができる。(4)ビー ムラインに常設の光学素子として,一般のユーザーが利用 可能である。本稿では,はじめに X 線透過型移相子の原 理を簡単に述べ、その利点について偏光可変挿入光源と比 較する。次に BL39XU における移相子の性能について報

告し,さらに最近開発した円偏光変調法による XMCD 測 定について述べる。

2. X 線透過型移相子

2.1 原理

シリコンやダイヤモンドなどの完全結晶に近い結晶をブ ラッグ回折条件の近傍で用いると、複屈折により透過光の σ -偏光と π -偏光成分の間に位相差が生じる。このことを 利用し、水平面内に直線偏光した放射光X線を、右 (RHC)および左回り(LHC)の円偏光X線に変換(λ / 4板)あるいは垂直面内の直線偏光に変換(λ /2板)する 移相子として用いることができる。動力学的理論による と、回折条件から離れた角度領域では移相子による位相差 δ は次のように表される²⁻⁶)。

$$\delta = -\frac{\pi}{2} \left[\frac{r_{\rm e}^2 {\rm Re}(F_{\rm h}F_{\rm h}^-)}{\pi^2 V^2} \frac{\lambda^3 \sin(2\theta_{\rm B})}{(\theta - \theta_{\rm B})} \right] t \tag{1}$$

$$= -\frac{\pi}{2} A \frac{t}{\Delta \theta} \tag{2}$$

* 高輝度光科学研究センター 〒679-5198 兵庫県作用郡三日月町光都 1-1-1

TEL 0791-58-0802 (ex. 3871) FAX 0791-58-2752 e-mail m-suzuki@spring8.or.jp

ここで r_e は古典電子半径, $F_h \ge F_h^-$ はそれぞれ hkl 反射 $\ge hkl 反射の結晶構造因子, Vは単位胞の体積, \lambdaはX$ $線の波長, <math>\theta_B$ はブラッグ角, θ は入射X線の視斜角を表 す。tは移相子中を通るX線の光路長であり,対称反射を 用いた透過ラウエケースでは移相子結晶の厚さ $t_0 \ge t=t_0/\cos\theta$ の関係がある。式(2)の $\Delta\theta$ は回折条件からのずれの 角度(オフセット角)を表す。A はそのほかの係数をま とめたもので,移相子として用いる物質,反射面,および X線の波長によって決まる。このように,移相子によっ て生じる位相差は結晶の実効的な厚さtに比例し,オフセ ット角 $\Delta\theta$ に反比例する。

例として,鉄のK-吸収端近傍のエネルギーE=7.12 keV (λ =1.74 Å)のX線に対して厚さ t_0 =0.73 mmのダ イヤモンド結晶を220透過ラウエケースで用いた場合を考 えると、A=109秒/mm が得られる。結晶中を通るX線 の光路長は t=1.01 mm となり、 $\Delta \theta = -110$ 秒において $\delta = \pi/2$ の位相差が生じる。このとき移相子は $\lambda/4$ 板とし てはたらき、透過光に円偏光が得られる。ブラッグ角に対 して逆方向にオフセット角を振ると、Δθ=+110秒におい て $\delta = -\pi/2$ の位相差が生じ、逆向きの円偏光が得られ る。円偏光のヘリシティを切り替えるには移相子結晶の角 度をわずか200秒程度変化させればよい。ヘリシティの切 り換えに必要な動きが小さいため、高速に偏光状態を切り 替えることが可能である。また,円偏光となる場合の半分 のオフセット角 $\Delta \theta = \pm 55$ 秒では $\mp \pi$ の位相差が得られる。 このとき移相子は λ/2 板としてはたらき,入射光の水平 直線偏光は垂直方向の直線偏光に変換される。

異なるエネルギーのX線に対して移相子を用いる場合, 係数AはX線の波長,すなわちエネルギーによって変化 するが,オフセット角Δθを最適に調整することにより, 比較的広い範囲のエネルギーに対してλ/4板あるいはλ/ 2板として機能する⁷⁾。ダイヤモンドは10keV前後のX 線に対する透過率が高いため,比較的厚い結晶を透過型移 相子として用いることができる。その結果,オフセット角 に対する位相変化が緩やかな領域で使用できる。このた め,ある程度発散したビームに対しても利用することがで きる。特にアンジュレーター光に対してはミラーやスリッ ト,非対称反射などのコリメーターを用いる必要が無い場 合が多く,高い効率で偏光状態の変換が可能である。

2.2 移相子による偏光制御のメリット

BL39XUでは、平面アンジュレーター挿入光源で発生 した水平面内の直線偏光X線をモノクロメーターで単色 化したのちに、移相子によって偏光状態の変換を行ってい る。特定の偏光状態をもつ放射光X線の生成を行う他の 方法は、ヘリカルアンジュレーターや楕円マルチポールウ ィグラーといった挿入光源を用いる方法である。これらの 偏光可変挿入光源を用いる場合と比較して、移相子によっ て直線偏光を他の偏光状態、特に円偏光に変換する方法に は以下に挙げるような利点がある。

(利点1)他の光学素子による偏光解消効果を受けない:移相子はビームラインの最終段に位置する光学素子であり,試料の直前で偏光状態の変換を行う。そのため,高い偏光度をそのまま利用することができる。一方,円偏光挿入光源では光源の元々の偏光度が高くても,途中のモノクロメーターやミラーなどの光学素子による偏光解消効果のために偏光度が低下することがある⁸⁾。

(利点2)様々な偏光状態が選択可能:移相子結晶の角 度をわずか数十秒から数百秒変化させるだけで偏光状態を 極めて短時間に切り替えられ,移相子の角度の調整によっ て様々な偏光状態のX線を生成することが可能である¹⁻⁶⁾。 現在 BL39XU で利用できる偏光を,**Table 1**に示す。

(利点3)高速偏光スイッチング: 偏光状態の変換に必要とされるメカニカルな動きが小さいため,高速あるいは 交番的に偏光状態のスイッチングを行うことができる⁹⁾。 BL39XU では XMCD 測定時に通常40 Hz で左右円偏光の 切り換えを行っている。このヘリシティの交番切り換えと ロックインアンプを用いた位相敏感検波法を組み合わせる ことにより X 線領域では初めて円偏光変調分光法を開発 し,XMCD の測定精度の向上に成功した^{10,11)}。

(利点4)導入が容易かつ低コスト:移相子による偏光 制御のために最低限必要な機器は,斜め45°に回転軸が傾 斜したゴニオメーターとダイヤモンド結晶のみである。ゴ ニオメーターには特別に精密なものは必要ない(BL39XU では0.72秒/パルスのものを使用している)。また, 0.4×0.4 m²のスペースがあれば十分に設置が可能であ る²⁾。SPring-8のほとんどの硬X線アンジュレータービ ームラインには直ちに導入が可能であり,設置に伴うシャ ットダウン期間も無い。偏光可変挿入光源と比べて遥かに 容易かつ低コストに偏光状態の制御を行うことができる。 導入の容易さという移相子の利点は,大いに強調されるべ きである。

(利点5)移相子による偏光状態の制御はX線に対して 行うものであるから、当然のことながら蓄積リングの電子 ビーム軌道には何の影響も及ぼさない。一方,偏光可変挿 入光源によって偏光状態をスイッチングする際には,挿入 光源の磁石列の移動によって電子ビーム軌道が変動する可 能性があり,常に注意を払う必要がある。

Table 1. Available polarization state of x-rays at BL39XU, SPring-8

polarization state	polarization rate	flux (ph/s/mm ²)*
horizontal linear	$P_{\rm L} > 99.9\%$	~10 ¹²
vertical linear	$ P_{\rm L} < 80\%$	1010~1011
right & left circular	$ P_{\rm C} > 90\%$	~1011
elliptical	0< P _C <90%	~1011

*Ring current 100 mA, XY-slit at the front-end 0.5×0.5 mm.

このように移相子による偏光の制御には多くのメリット がある。しかし、もちろんデメリットも存在する。それら を以下に挙げる。

(デメリット1)移相子による吸収のため,利用できる X線強度が減少する:移相子に用いているダイヤモンド 結晶の透過率は数%から数十%であり,数分の1から1 桁程度X線強度が減少する。これを解決するには,薄い 結晶を用いるなどして吸収を減らせばよい。しかし現在入 手できる最も薄い結晶は厚さ0.2 mm 程度であり,6 keV 以下ではやはり透過光強度が大きく減少する。また,入射 光の発散角が有限であるため,薄すぎる結晶を使うと偏光 度が低下してしまう。そのため,透過光強度と偏光度との トレードオフを考慮する必要がある。

(デメリット2)利用できるエネルギー範囲が限られ る:現在,ダイヤモンド移相子を使用できるエネルギーは 6~15 keV である。低エネルギー側は原理的には回折の起 るエネルギー(111反射で3 keV)で制限されるが,移相 子結晶による吸収が増え透過光強度が減少するために,実 際には6 keV 以下での利用が難しい。高エネルギー側の 制限は入射光の発散角とエネルギー幅,および結晶の回折 幅によるものである。ある厚さの移相子に対して,所定の 位相差を与えるオフセット角はエネルギーの3乗に反比 例する。入射光が有限の発散角とエネルギー幅を持ち,結 晶の回折幅も有限の値を持つ。そのため,それ以下のオフ セット角で最適条件となるような高エネルギーに対しては 使用できない。

3. SPring-8 BL39XU 生体分析ビームライン

3.1 ビームラインの概要

BL39XU¹²⁻¹⁵⁾は真空封止型アンジュレーターを光源と する硬X線ビームラインである。1997年10月から共同利 用実験に提供され,主に磁気散乱・吸収実験,微小領域や 微量元素の化学状態分析,および臨床医学試料等の分析に 利用されている。本ビームラインの特長は,(1)分光器下流 に設置された全反射鏡により高調波成分の少ない単色X 線が得られ,(2)X線透過型移相子により偏光状態の制御 が行えることである。SPring-8においては,移相子を常 設し共同利用実験に供している唯一のビームラインであ る。

3.2 挿入光源および光学系

ビームラインの模式図を Fig.1 に示す。挿入光源は SPring-8 標準の真空封止型平面アンジュレーター¹⁶⁾(周 期長32 mm,周期数140)である。水平面内に直線偏光し た X 線を発生する。光源から29 m の位置のフロントエン ド部に最大開口1×1 mm の XY スリットが設置されてい る。光源から36 m の位置には SPring-8 標準の Si 111回 転傾斜型二結晶分光器¹⁷⁾が設置されている。第一結晶は ピンポスト水路加工された直接水冷型^{18,19)}であり,第二結 晶はバルク結晶を間接冷却で用いている。分光器の下流, 光源から44 m の位置に平面ミラーが設置され,高調波の 除去を行っている。ミラーの上流および下流にはそれぞれ XY スリットがあり,ビームの整形やミラーを透過した高 調波成分の除去に利用される。光源から46 m の位置にあ るべリリウム窓を通して単色 X 線が実験ハッチ内に取り 出される。

実験ハッチ内で得られる X 線の性質を Table 2 に示す。 利用できる X 線のエネルギーは5.7~37 keV である。二 結晶分光器は Si(111)面を反射面として用いており、5~ 37 keV の単色 X 線を選択できる。一方、アンジュレータ ーギャップの可動範囲は9.6~50 mm であり、最小ギャッ プ9.6 mm における基本波のエネルギーは5.7 keV である。 高エネルギー側は 3 次および 5 次高調波を使うことによ って37 keV 以上をカバーできる。

アンジュレーターギャップとモノクロメーターの連係制 御を行っており、どのエネルギーにおいてもアンジュレー タースペクトルの最大強度を利用することができる。ギャ ップ値とアンジュレーターのピークエネルギーの関係を測 定したテーブルを以下のような関数を用いてフィットし、 目的のX線のエネルギーを与えるギャップ値を得ている。

Table 2. BL39XU X-ray beam parameters

5.7~37 keV	
$\sim 1 \times 10^{-4*}$	
$1 \times 10^{13} \text{ ph/s} (100 \text{ mA})^*$	
$0.5 \times 1.3 \text{ mm}^2 (V \times H)^*$	
$< 1 \times 10^{-4}$	

*XY slit at front end 0.5×0.5 mm², x-ray energy 7.74 keV.



Figure 1. Layout of beamline BL39XU of SPring-8.

$$d = \alpha \ln \left(\frac{\beta}{E} - 1\right) + \gamma \tag{3}$$

ここでdはアンジュレーターのギャップ値, EはX線の エネルギー, α , β , γ はそれぞれフィッティングパラメー ターである。式(3)では平面アンジュレーターの軸上放射 に対するピーク波長とK値との関係²⁰⁾を用い, K値とギ ャップ値との関係に指数関数を仮定している。こうして得 られたフィッティングパラメーターを用いてギャップ値を 決定することにより, アンジュレーター基本波のエネルギ ーを 誤 差10 eV 以内 で 制 御 で き て い る 。EXAFS や XMCD などの測定では, アンジュレーターの存在を意識 することなく, あたかも白色光源を利用するようにほぼ一 定の入射光強度でスペクトル測定を行っている。

高調波除去ミラーは全長0.7 mのPt 蒸着平面鏡を用い ている。視射角は最大9 mrad まで可変であり,カットオ フエネルギーの最低値は8 keV である。ミラーを利用す る場合,下流の光軸は視射角の2 倍の角度だけ水平面内 に偏向する。ミラー視射角に連動して下流のXY スリッ ト2 およびベリリウム窓が光軸上に移動する並進機構を 備えている。いくつかの視射角およびエネルギーついての ミラーの反射率の測定により,基本波に対する3 次高調 波の強度比を10⁻⁴ 以下に低減できていることを確認し た¹⁵⁾。

3.3 移相子用ダイヤモンド結晶およびステージ

移相子として用いているのは人工ダイヤモンド(111)結 晶である。220面の対称ラウエ配置で使用している。水平 面内に直線偏光した入射 X 線によって σ -, π -偏光成分を 1:1の振幅で励起するために,結晶の ω 軸が水平面から 45°傾いた ω -2 θ 回転ステージ(神津精機株式会社製)上 に設置している。**Figure 2** にステージの写真を示す。

ダイヤモンド結晶は住友電気工業株式会社から供給され たものである。ダイヤモンド単結晶のサイズの大型化と結 晶性の向上を目指し,住友電工と理化学研究所との間で研 究開発が進められてきた。現在までに最長辺8 mm 以上, 回折強度のロッキングカーブの半値幅が理論値の2倍程 度の良質な単結晶が得られるようになった。結晶の厚さは X線のエネルギーに応じて0.45,0.73,4 mm の3種類を使 い分けている。それぞれ 6~9,8~12,11~16 keV をカバ ーする。**Figure 3** に,厚さ0.45 mm の結晶の写真を示 す。

3.4 実験ステーション

実験ハッチ内には,磁気散乱・吸収実験用の回折計²¹⁾, 電磁石およびクライオスタット,微小領域分析装置¹³⁾, 斜入射X線分析装置²²⁾が常設されている。これらの装置 は磁気散乱・吸収サブグループおよび分析サブグループの 建設メンバーによって立ち上げられた。各装置の詳細につ



Figure 2. An ω -2 θ stage used with an X-ray phase retarder.



Figure 3. One synthetic diamond (111) crystal used as an X-ray phase retarder. The thickness is 0.45 mm.

いては、それぞれの文献をご参照いただきたい。

4. ビームラインにおける移相子の性能

4.1 アンジュレーター光の偏光度

この節ではビームラインにおけるダイヤモンドX線移 相子の性能,特に得られる偏光度について述べる。はじめ にアンジュレーター光源の偏光度測定の結果を紹介する。



Incoming x-ray (horizontally polarized)

Figure 4. Experimental setup for linear polarization measurements.

Figure 4 に直線偏光度測定のための光学系の配置を示 す。光源の偏光度の測定は移相子を光軸から外して行っ た。X線のエネルギーは8.389 keV, アンジュレーターギ ャップは12.735 mm, フロントエンド XY スリット開口 0.5×0.5 mm, 実験ハッチ内 XY スリット開口0.5×0.5 mm(光源から46m)の条件で測定を行った。アナライザ ーとして Si(333) チャンネルカット結晶を用いた。上記の エネルギーにおいて, Si 333反射のブラッグ角は45°とな る。モノクロメーターは±1 eV 以内にエネルギー較正し, アンジュレーター基本波のピークがこのエネルギーに合う ようにギャップ値を設定した。検出器はイオンチェンバー を用いた。アナライザー結晶のの軸まわりのロッキング カーブの積分反射強度を,χ軸まわりの回転角の関数とし て測定した。測定時の蓄積リングのフィリングモードは 2/3フィル,水平-垂直方向のカップリング係数は0.07%で あった。

測定結果を Fig. 5 に示す。横軸は χ 軸まわりの回転角, 縦軸は規格化された積分反射強度 $I(\chi)$ である。 $\chi=0^{\circ}$ は アナライザー結晶の反射面が垂直方向となる角度を意味し ている。測定結果は周期180°のサインカーブの関係を示 している。ほぼ $\chi=\pm90^{\circ}$ で極小値をとり,そこでの積分 反射強度は $\chi=0^{\circ}$ における極大値と比べて10⁻⁴ 以下であ る。この結果は,モノクロメーターで単色化されたアンジ ュレーター光がほぼ完全な直線偏光であり,水平面内に偏 光していることを示している。直線偏光度を定量的に見積 るため,測定値を以下のような関数で最小二乗フィットし た。

$$I(\chi) = I_0 (1 + P_L \cos 2\chi + P_{45} \sin 2\chi)$$
(4)

ここで各パラメーターは規格化されたストークスパラメー ターを意味し、 $P_{L}=S_{1}/S_{0}, P_{45}=S_{2}/S_{0}$ の関係がある。こ の解析ではサインカーブの谷付近の値が重要であるため、 各測定値の対数の逆数の重みをつけてフィッテングを行っ た。フィッティングの結果、 $P_{L}=0.9998, P_{45}=-0.0087$ という値が得られた。これらの値に対して、



Figure 5. Result of linear polarization measurement of undulator radiation at 8.389 keV. The integrated intensity *I* is plotted as a function of the azimuthal angle, χ , of the Si(333) channel-cut analyzer.

$$P = \sqrt{P_{\rm L}^2 + P_{45}^2} \tag{5}$$

の関係を用いると、アンジュレーター光の偏光度は P= 99.98%と求められる。測定系のダイナミックレンジが十 分でないため、偏光度の4桁目の値は確かではない。し かし、BL39XUで行われた非共鳴X線磁気回折実験にお ける偏光因子の測定から、入射X線の偏光度が99.97%と いう結果が得られており²³⁾、我々の結果とよく一致して いる。分光器で単色化されたアンジュレーター光の偏光度 は、99.9%以上であると結論できる。

4.2 ダイヤモンド X 線透過型移相子による偏光状態の変換

このように非常に高い偏光度で水平面内に直線偏光した アンジュレーター光に対して透過型X線移相子を用い, 偏光状態の変換を行った。偏光状態の評価に用いた光学系 は Fig. 4 に示したものと同じである。*I*0 モニターのイオ ンチェンバーの上流に厚さ0.73 mm のダイヤモンド移相 子を挿入した。入射X線のエネルギーは7.120 keV, アン ジュレーターのギャップ値は11.4 mm に設定した。この ときの基本波のピークエネルギーは7.14 keV である。ア ナライザーとして用いたのは Si(331)のチャンネルカット 結晶である。上記のエネルギーにおけるブラッグ角は 44.435°であり,消光比は4×10⁻⁴ と見積ることができ る。

測定を行ったのは,移相子のオフセット角 $\Delta\theta = \pm 58$ 秒 (ともに $\lambda/2$ 板), -103秒($\lambda/4$ 板)の3つの場合である。 **Figure 6**に $\Delta\theta = -58$ 秒(白三角)と-103秒(黒丸)に ついての結果,そして移相子を用いない元の入射光に対す る結果(白丸)を比較のために示す。**Figure 5**の結果と 同様に,元の入射光では積分反射強度 $I(\chi)$ は $\chi=0^{\circ}$ で極 大, $\chi=\pm90^{\circ}$ で極小値をとる。一方,移相子を $\Delta\theta = -58$ 秒で用いた場合には,逆に $\chi=0^{\circ}$ で極小, $\chi=\pm90^{\circ}$ で極大



Figure 6. Results of linear polarization measurement with a diamond X-ray phase retarder at 7.120 keV. The phase retarder worked as a halfwave plate with $\Delta \theta = -58$ arcsecond (open triangles), and as a quarterwave plate with $\Delta \theta = -103$ arcsecond (filled circles). The open circles show $I(\chi)$ measured with the original undulator radiation without phase retarder. Solid lines are fits to the data.

という結果が得られた。これは垂直面内の偏光が得られた ことを意味しており,移相子が $\lambda/2$ 板として機能してい ることがわかる。入射光では $I(\chi)$ の極小値がほぼ完全に ゼロであるのに対して, $\Delta \theta$ =-58秒で用いた場合には, 0.1程度の値が残っている。これは入射光よりも直線偏光 度が低いことを示している。また,オフセット角 $\Delta \theta$ = -103秒の場合には, $I(\chi)$ は光軸回りの回転角 χ に依存せ ずほぼ一定であった。 $\Delta \theta$ =-103秒において移相子が $\lambda/4$ 板としてはたらき,円偏光に近い偏光状態が得られている ことがわかった。しかし,この測定で用いた直線検光子の みの光学系による測定では原理的に円偏光と自然光成分の 区別はできず,円偏光の向きも知ることはできない。

測定された $I(\chi)$ を式(4)を用いてフィッテングし,規 格化されたストークスパラメーター PL と P45 を求めた。 その結果を Table 3 にまとめて示す。 $\Delta \theta = \pm 58$ 秒の2つ の結果を比べると、ほぼ等しいPLの値が得られているこ とがわかる。これは、絶対値の等しい正負のオフセット角 において等しい直線偏光度のX線が生成されていること を示しており、動力学的理論から予測される結果である。 しかし、直線偏光度の絶対値は0.83であり、入射光よりも 偏光度が低下している。これは入射光の角度発散とエネル ギー分散によるものとして説明できる。Figure 7 に,オ フセット角 Δθ に対する PL の変化を示す。白丸は測定結 果である。実線は入射光の角度発散に幅22秒(FWHM) のガウス関数を仮定した場合の計算結果であり、実験結果 をよく再現している。計算に用いた角度発散の値は今回の 実験配置におけるダイヤモンド220反射のロッキングカー ブ幅24秒にほぼ一致している。

オフセット角 Δθ の符合を変化させることで円偏光のへ リシティが切り替えられることは、純鉄の Fe K-吸収端

Table 3. Measured Stokes parameters

$\Delta \theta$ (arcsecond)	P_{L}	P ₄₅
-58	$-0.83 {\pm} 0.01$	0.04±0.01
+58	$-0.82 {\pm} 0.01$	$-0.00 {\pm} 0.01$
-103	$-0.04 {\pm} 0.01$	$-0.02 {\pm} 0.01$



Figure 7. The variation of the degree of linear polarization $P_{\rm L}$ with the offset angle $\Delta \theta$. The experimental values (open circles) are compared with the theoretical curve obtained from the convolution by a Gaussian function of 22 arcsecond FWHM.

の XMCD スペクトルの符号が完全に反転することで確認 した²¹⁾。また、ダイヤモンド移相子 2 枚と Si チャンネル カットアナライザー結晶を用いた円偏光測定用の光学系を 構成し、移相子によって生成した円偏光の偏光状態をヘリ シティまで含めて完全に決定する実験を最近行った²⁴⁾。 その結果、E=8.389 keV における円偏光度の絶対値は RHC, LHC ともに $P_{C}=90\%$ であった。移相子のオフセッ ト角を周波数40 Hz で変化させている場合にも円偏光度の 低下はみられず、ヘリシティが交番的にほぼ完全に反転し ていることを確認した。

4.3 簡易型偏光モニター

上に述べたような結晶光学素子による測定を行えば,高 精度に偏光状態や偏光度を決定することができる。しかし セットアップや測定に時間がかかることや,X線のエネ ルギーを変更した場合に光学系の再調整が必要であるこ と,アナライザー結晶を光軸上に置いたままでは試料の測 定が行なえないという理由から,常時偏光状態をモニター する用途には向かない。BL39XUでは移相子透過光の偏 光状態を簡便にモニターするために,カプトン膜からの弾 性散乱の偏光依存性を利用した簡易型偏光モニター²⁵⁾を 利用している。これは容易に光軸に挿入することができ, 透過光を用いて試料の測定を行うこともできる。

4.2節で用いた移相子のオフセット角 $\Delta \theta = \pm 58$ 秒と -103秒は,前もって簡易型偏光モニターによって決定したものである。アナライザー結晶を用いたより高精度な偏 光測定の結果,それぞれ $\lambda/2$ 板と $\lambda/4$ 板としてほぼ望み 通り機能することが確認された。XMCD や偏光 EXAFS など移相子を用いたスペクトル測定を行う際には、モノク ロメーターのエネルギースキャンに連動して移相子の角度 をチューンする必要がある。簡易型偏光モニターを用いて 望みの偏光状態を与える移相子角度のエネルギー依存性の テーブルを前もって作成し、そのテーブルに基づいて移相 子を制御を行うことで広いエネルギー範囲にわたって望み の偏光状態を得ることができている。

5. 円偏光変調法による XMCD 測定

5.1 はじめに

BL39XUではXMCDの測定に円偏光変調法を用いている。これはダイヤモンドX線透過型移相子による円偏 光ヘリシティの交番切り換えと、ロックインアンプによる 位相敏感検出法を組み合わせることにより開発した測定法 であり、従来の磁場反転法と比較して、格段に統計精度の 高いXMCDスペクトルを短時間で得ることができる^{10,11}。

XMCD は,入射 X 線と平行な方向に磁化した試料の, 左右の円偏光に対する吸収係数の差として定義される。硬 X 線領域に観測される XMCD の信号強度は軟 X 線領域 と比較して1桁から2桁小さく,3d 遷移金属の K-吸収 端における XMCD の信号強度は0.1%のオーダーである。 このように微弱な信号を所定のビームタイム内で測定し, 試料組成依存性や温度依存性,磁場依存性等を議論するに 十分な精度を得ることが要求される。

これまで PF などで行われた XMCD 測定は、ほとんど が磁場反転法と呼ばれる方法によるものであった。この測 定法では、ヘリシティが固定された(楕)円偏光を試料に 入射し, 試料に印加する磁場の方向を入射 X 線の方向に 対して平行と反平行に切り換える。各磁場方向において吸 収係数を測定し、それらの差分から XMCD を得ていた。 磁場反転法における統計精度は原理的に通常の吸収測定と 同等であり、0.1%オーダーの信号を解析に十分なS/N比 で測定するためには、それぞれの磁場方向について長い積 算時間が必要であった。そのため入射光強度が比較的長い 時間スケールで安定であることが要求される。また、外部 磁場の反転によって試料の磁化が完全に反転しない場合に は系統的な誤差を生じることや、試料の磁化が飽和する過 程での測定が行なえないという制約がある。さらに、磁場 方向の反転に時間のかかる超伝導マグネットは実質的に利 用できず, 強磁場下での XMCD 実験は容易ではなかっ た。

このようなデメリットがあるにもかかわらず磁場反転法 が用いられてきたのは、第二世代光源における円偏光へリ シティ切り換えの制約のためである。X線透過型移相子 の実用化により円偏光へリシティの切り替えが高速に行な えるようになったため、もはや磁場方向を切り替える必要 はない。我々は、X線移相子によってへリシティが40 Hz で周期的に切り替わる円偏光を発生し、ロックインアンプ を用いてヘリシティ変調の周波数に同期した信号のみを検 出することにより,XMCD 測定の S/N 比を格段に向上す ることに成功した。

移相子によって円偏光 X線を生成し XMCD 測定に応 用した例は、これまでにいくつか報告されている。しか し、高速ヘリシティ切り換えとロックイン法を用いること により、測定精度の向上を行ったのは我々が初めてであ る。平野らは移相子によって生成した円偏光を用いて Pt-Fe 合金の XMCD 測定を行っている⁴⁾。しかし、円偏光の ヘリシティは固定であり、磁場反転法を用いての測定であ る。ESRF のグループは分散型モノクロメーターと移相 子を組み合わせ、ヘリシティ反転による XMCD 測定を行 っている^{5,6)}。しかし,彼らは比較的長い時間スケール(数 十秒~数十分)でヘリシティの切り換えを行っており、信 号処理は従来通りの時間積算によっている。したがって, 入射 X線強度に関して磁場反転法と同程度の安定性が依 然として求められる。その結果, XMCD の統計精度は我 々の偏光変調法よりも低く,彼らの報告している XMCD のデータは信号強度が比較的大きい(%オーダー)のスペ クトルに限られていることを強調したい。

5.2 セットアップと測定方法

Figure 8 に偏光変調 XMCD 測定のセットアップを示 す。このセットアップには鍵となる2つの要素がある。1 つは X 線移相子による高速ヘリシティ切り換えであり, これはピエゾ圧電素子駆動による移相子結晶振動台⁹⁾を用 いて行った。もうひとつの要素はロックイン法による XMCD 信号の直接検出であり,吸収係数に相当する電圧 信号を得るためのアナログ演算回路とロックインアンプを 組み合わせることにより実現した。

最初に移相子による高速ヘリシティ切り換えについて説 明する。分光器からの単色X線は移相子に入射し,水平 面内の直線偏光から円偏光へと変換される。移相子結晶は ピエゾ圧電素子によって駆動される振動台(神津精機製)



Figure 8. Experimental setup for X-ray magnetic circular dichroism measurements using our helicity-modulation technique.

に乗っており、ピエゾ振動台は45度傾斜回転軸を持つω-2 θ 回転ステージ(**Fig. 2**)上に取り付けられている。 ω - 2θ ステージにより、移相子の角度をブラッグ角 $\theta_{\rm B}$ に調整 した後に、ピエゾ素子振動台により移相子の角度を $\theta_{\rm B}$ を 中心として周波数40 Hz で振動させる。振動の振幅 Δθ を 円偏光生成に最適な角度になるように、ピエゾ素子に加え る交流電圧を調節する。このようにして, RHC と LHC の円偏光を40 Hz の周波数で切り替えて発生している。ピ エゾ素子振動台の写真を Fig. 9 に示す。ピエゾ素子はス トローク60 µm の低電圧タイプ (Physik Instrumente P-841.40)を使用した。この素子は歪みゲージセンサーを 備えており閉ループ制御を行っている。移相子によって円 偏光に変換された X線は電磁石によって磁化された試料 に入射する。磁場方向は入射X線に対して45度だけ傾い ている。偏光変調法では磁場方向の反転ではなく円偏光の ヘリシティを反転させることによって XMCD を測定す る。したがって、1本のスペクトル測定の間、電磁石の極 性は一方向に固定したままである。

ここで、偏光変調法では XMCD の信号をどのようにし て検出するかについて述べる。試料の RHC と LHC のフ ォトンに対する吸収係数を、それぞれ $\mu_{+\tau}$ および $\mu_{-\tau}$ と 定義する(τ は試料の厚さ)。上に述べたような交互にへ リシティが切り替わる円偏光が試料に入射すると、ヘリシ ティの交番に同期して吸収係数が $\mu_{+\tau} と \mu_{-\tau}$ との間で振 動する。入射光の偏光状態を交番することによって試料の 透過光強度が変調されるわけである。この吸収係数の振動 の振幅

$$\Delta\mu\tau = \mu_{+}\tau - \mu_{-}\tau \tag{6}$$

が直接に XMCD を与え,時間平均



が通常の吸収を与える。

 $\bar{\mu}\tau = (\mu_+\tau + \mu_-\tau)/2$

X線強度 Io および透過 X線強度 I は 2 台のイオンチェン バーで測定される。これらの電流信号は、カレントアンプ (KEITHLEY 428) によって電圧信号 V(I₀) と V(I) にそ れぞれ変換されたのちに、対数変換回路に入力される。対 数変換回路はアナログ演算を行い,吸収係数 $\mu \tau = \ln \left[V(I_0) \right]$ /V(I)]に比例した電圧信号 $V(\mu\tau)$ を出力する。式(6)に 示したように、 $V(\mu\tau)$ の交流成分すなわち振幅は XMCD に比例する。ロックインアンプ(EG&GPARC 5210)で 偏光変調の周波数に同期した交流電圧成分を測定すること により, XMCD 信号が得られる。一方, 式(7)より, V(μτ)の直流成分すなわち時間平均は通常の吸収に相当 し, デジタルマルチメーター(KEITHLEY 2000)で測 定される。このようにして,XMCD と通常の吸収を直接 にしかも同時に測定している。ロックインアンプを用いる ことにより、測定系の Q 値を高くし、 偏光変調の周波数 の近傍で帯域幅を制限することが容易にできる。そのた め、ノイズのパワースペクトルうち大部分の周波数成分を 落とすことができ、測定データのS/N比が格段に向上し た。ロックインアンプの前段に対数変換回路を用いる理由 は、 Io と I に共通に含まれる入射光の強度変化を除くため である。移相子の角度を回折条件の前後で変化させて円偏 光ヘリシティの切り換えを行うと,ボルマン効果により左 右円偏光の透過光強度に数%の差が生じる。この強度変化 はヘリシティ切り換えの周波数と同期しているため、ロッ クインアンプで直接に試料透過光強度 I を測定した場合に は、XMCDの信号に大きなバックグラウンドが乗ってし まうことになる。そこで、ロックインアンプに入力する前 に I₀ と I についてアナログ演算処理を行い,両者に共通 に含まれる強度変動をキャンセルしている。このようにす ることで,XMCDのバックグラウンドレベルは0.01%の オーダーに押さえられている。

5.3 円偏光変調法による XMCD スペクトル

偏光変調法による XMCD スペクトルの測定例を Fig. 10に示す。図の上段に示したのは、CoFe₂O₄ 試料の鉄の K-吸収端(E_0 =7.110 keV)における XMCD スペクト ル¹¹⁾である。下段のグラフは同じ試料の XANES スペク トルである。 E_0 -33 eV から E_0 +87 eV の120 eVのエネ ルギー範囲において、1 eV のステップでスペクトルを測 定した。ロックインアンプの時定数は1秒であり、1つの 測定点につき10秒間積算した。約30分で1本のスペクト ルが得られた。なお、図に示した XMCD スペクトルは2 回の測定の平均であり、合計の測定時間は約1時間であ る。対数変換回路によって掛かる係数および円偏光へリシ ティ切り替えのデューティ比を考慮して、ロックインアン



(7)



Figure 10. An X-ray magnetic circular dichroism spectrum at the Fe K-edge of $CoFe_2O_4$, measured using our helicity-modulation technique. A XANES spectrum of the sample is shown in the bottom.

プで測定した生データから XMCD の値を求めた。円偏光 度に対する補正は行っていない。XANES スペクトルのエ ッジジャンプは生データのままである。

全測定範囲にわたって S/N 比の高いスペクトルが得ら れている。特に,吸収端より高エネルギーの領域の微細構 造が高い S/N 比で観測されていることに注目したい。吸 収端よりも高エネルギーでは試料の透過光強度が減少する ため,従来の測定法では高精度な XMCD スペクトルを測 定することが容易ではなかった。吸収端から+62 eV のエ ネルギーに,多電子励起(multi-electron excitation)に 起因すると考えられる構造²⁶⁾が明瞭に観測されている。 吸収端よりも低エネルギー側の領域($-33 \sim -5 \text{ eV}$)で の測定値ばらつきは,0.01%以下であり,測定の統計精度 はそれと同程度であると見積ることができる。1 点わずか 20秒の測定時間で10⁻⁵ 乗台の統計精度が得られている。

Figure 10に示した偏光変調法による XMCD スペクト ルと, PF の BL-28B²⁷⁾において従来の磁場反転法で測定 された同一試料のスペクトル²⁸⁾との比較を行った。両者 のスペクトルはよく一致し,偏光変調法は正しいスペクト ルを与えることが確認された。XMCD の絶対値は偏光変 調法の方が大きかった。これは光源にマルチポールウィグ ラーを用いた BL-28B と,直線アンジュレーターと移相 子を使った BL39XU の円偏光度の違いによるものである と考えられる。両者のスペクトルの S/N 比と測定に要し た時間を比較すると,円偏光変調法を用いることで,磁場 反転法と比較して1/10の測定時間でおよそ2倍 S/N 比の 高い XMCD スペクトルが得られた。注意したいのは、そ れら2本のスペクトルを測定した時の試料位置でのフォ トンフラックスがほぼ同じだったということである。図に 示したスペクトルは1998年の5月に測定されたものであ り、SPring-8 蓄積リングの蓄積電流は現在の1/5の20 mA であった。またアンジュレーター光の取り込み角は水 平、垂直とも10 µrad であった。一方、PF は300 mA 運 転であり、BL-28B はマルチポールウィグラーからのX 線を水平方向4 mrad、垂直方向0.2 mrad 取り込み、ミラ ーで試料位置に集光している。その結果、試料位置でのフ ラックスは両ビームラインで大差ない。したがって、 XMCD の精度の違いは偏光変調法と磁場反転法の違いに よるものであるといえる。

BL39XUにおいて、純鉄の同一試料のK-吸収端におけるXMCDスペクトルを偏光変調法と磁場反転法とで測定し、得られたデータのS/N比を比較した¹⁰⁾。偏光変調法を用いた場合、磁場反転法に比べて1/6の測定時間であるにもかかわらず、よりS/N比の高いスペクトルが得られた。特に吸収端よりも高エネルギーで精度の差が顕著に現われた。

5.4 応用と今後の展望

円偏光変調法による XMCD 測定システムが立ち上がっ ておよそ1年半が経過し,多くの共同利用実験に利用さ れている。上に示した CoFe₂O₄ 試料以外にも,様々な遷 移金属や希土類を含む化合物に対して円偏光変調 XMCD 測定が行われ,高 S/N 比のスペクトルが短時間で得られ ている。移相子の回折角と振動の振幅を入射 X 線のエネ ルギーに応じて最適に調整することにより,Mn K-吸収 端(6.5 keV)から Pt L₂-吸収端(13.3 keV)のエネルギ 一範囲で円偏光変調法が利用できることを確認した。この ように広いエネルギー領域で高精度な測定が行えるという 特長を生かし,磁気 EXAFS 実験への応用が考えられる。

円偏光変調 XMCD 法には高精度というだけでなく, 試 料に印加する磁場の自由度が大きいというもうひとつの特 長がある。したがって, 強磁場下での XMCD 測定, ある いは XMCD の磁場依存性といった実験がただちに可能と なる。従来の方法では磁場方向の反転が不可欠であるた め, 超伝導マグネットを使用した強磁場下での XMCD 測 定は事実上不可能であった。超伝導マグネットの磁場の反 転に少なくとも数分を要するからである。偏光変調法では 磁場の反転は必要ないので, 問題なく超伝導マグネットと 組み合わせることができる。

磁場の自由度を活用した研究例として、姫工大のグルー プによる元素選択的磁化過程の観測があげられる。彼らは Gd/Fe 多層膜試料のガドリニウムのL₃-吸収端,および 鉄の K-吸収端の XMCD の磁場依存性の測定を行い、元 素個別の磁気ヒステリシスを得ている²⁹⁾。

これまで、磁性研究の基本的なプローブは磁化測定であ

り、試料磁化の磁場依存性および温度依存性によって磁性 に関する情報を得ていた。X線領域の円偏光変調法が開 発されたことにより、XMCD 測定における磁場の制限が 大幅に緩和され、磁化測定と同じ磁場および温度の条件下 で XMCD を観測することが可能となった。従来、磁化測 定でマクロスコピックに見ていた現象を XMCD を用いて 元素選択的、あるいはサイト選択的に観測するのである。 XMCD の磁性研究への応用範囲が格段に拡がり、磁性研 究の道具としての価値が一段と高まることが期待される。

6. おわりに

本稿では、第3世代放射光施設である SPring-8の BL39XUにおけるダイヤモンドX線透過型移相子の現状 を、ビームライン装置技術の立場から述べた。透過型移相 子の原理や基礎研究はすでに完成されたものである。我々 はそれを共同利用ビームラインに導入し、常時利用できる ように周辺の装置の整備を行った。その結果、ビームライ ンに既存のアンジュレーター光源やモノクロメーターと組 み合わせてX線の偏光状態を制御するための素子として 有効にはたらくこと、X線ビームの発散角といった光源 の性質から期待される所定の性能が得られていることを示 した。また、高速偏光スイッチングという移相子の利点を 生かし、X線領域で初めて円偏光変調分光法を開発し、 XMCDの測定精度を大きく向上させることに成功した。

本文中で述べたように,直線アンジュレーターと移相子 の組み合わせは偏光可変挿入光源よりも多くのメリットを 提供する。したがって,移相子を利用できるエネルギー範 囲の拡大が重要な課題となる。現在偏光可変光源でしかカ バーできないエネルギー領域においても移相子による偏光 状態の制御を行うことを目標としたい。低エネルギー側の 拡大については,特に3keV付近の領域の移相子が円偏 光素子として重要である。Si111反射のブラッグ角が45° に近付くため,挿入光源の円偏光度がモノクロメーターに よって激減するからである。一方,20keV以上の高エネ ルギーでは最近提案された複数枚移相子³⁰⁾によってある 程度領域を拡大できると期待される。

ビームラインにおける X 線移相子の実用化および円偏 光変調法の開発は,石川哲也,河村直己(理研),水牧仁 一朗(JASRI)の各氏との共同研究として行われました。 前ビームライン担当者の後藤俊治氏(JASRI)にはビー ムラインの建設および立ち上げ段階において多くのご尽力 をいただきました。圓山裕,上村重明,浦田顕理,北本 直也(岡山大)の各氏は円偏光変調法による XMCD 測定 を数多く行われ,偏光変調法の実用化に御協力いただきま した。アンジュレーター光源および移相子透過光の偏光測 定は,上記の方々に加え,栗林勝,国分淳,萩原一 成,堀江和宏,石田興太郎(東理大)の各氏と共同で行わ れました。伊藤正久(姫工大),荒川悦雄(東学大),平野 馨一,岸本俊二(物構研)の各氏には X 線磁気回折実験 に共同研究者として参加させていただき,有益な議論と多 くの情報を頂戴しました。ここに感謝の意を表します。ま た,BL39XU磁気散乱・吸収サブグループ,分析サブグ ループの方々から助言やご協力をいただきました。どうも ありがとうございました。

参考文献

- K. Hirano, K. Izumi, T. Ishikawa, S. Annaka and S. Kikuta: Jpn. J. Appl. Phys. 30, L407 (1991).
- 2) 平野馨一:放射光 11,238 (1998).
- K. Hirano, T. Ishikawa and S. Kikuta: Rev. Sci. Instrum. 66, 1604 (1995).
- 4) K. Hirano and H. Maruyama: Jpn. J. Appl. Phys. **36**, L1272 (1997).
- C. Giles, C. Malgrange, J. Goulon, F. de Bergevin, C. Vettier, A. Fontaine, E. Dartyge and S. Pizzini: Nucl. Instr. and Meth. A349, 622 (1994).
- C. Giles, C. Malgrange, J. Goulon, F. de Bergevin, C. Vettier, A. Fontaine, E. Dartyge, S. Pizzini, F. Baudelet and A. Freund: Rev. Sci. Instrum. 66, 1549 (1995).
- K. Hirano, K. Kanzaki, M. Mikami, M. Miura, K. Tamasaku, T. Ishikawa and S. Kikuta: J. Appl. Cryst. 25, 531 (1992).
- 8) T. Ishikawa: Rev. Sci. Instrum. 60, 2058 (1989).
- K. Hirano, T. Ishikawa, S. Koreeda, K. Fuchigami, K. Kanzaki and S. Kikuta: Jpn. J. Appl. Phys. 31, L1209 (1992).
- M. Suzuki, N. Kawamura, M. Mizumaki, A. Urata, H. Maruyama, S. Goto and T. Ishikawa: Jpn. J. Appl. Phys. 37, L1488 (1998).
- M. Suzuki, N. Kawamura, M. Mizumaki, A. Urata, H. Maruyama, S. Goto and T. Ishikawa: J. Synchrotoron. Rad. 6, 190 (1999).
- 12) S. Goto, M. Yabashi, H. Ohashi, H. Kimura, K. Takeshita, T. Uruga, T. Mochizuki, Y. Kohmura, M. Kuroda, M. Yamamoto, Y. Furukawa, N. Kamiya and T. Ishikawa: J. Synchrotron Rad. 5, 1202 (1998).
- S. Hayakawa, S. Goto, T. Shoji, E. Yamada and Y. Gohshi: J. Synchrotron Rad. 5, 1114 (1998).
- 14) SPring-8 Annual Report 1998 (now printing).
- 15) 鈴木基寛: SPring-8 利用者情報 4(2), 30 (1999).
- 16) T. Hara, T. Tanaka, T. Tanabe, X. M. Maréchal, S. Okada and H. Kitamura: J. Synchrotron Rad. 5, 403 (1998).
- M. Yabashi, H. Yamazaki, K. Tamasaku, S. Goto, K. Takeshita, T. Mochizuki, Y. Yoneda, Y. Furukawa and T. Ishikawa: *Proc. SPIE* 3773, 2 (1999).
- 18) M. Kuroda, H. Yamazaki, M. Suzuki, H. Kimura, I. Kagaya, C. Yamashita and T. Ishikawa: J. Synchrotron Rad. 5, 1211 (1998).
- H. Yamazaki, H. Kimura, I. Kagaya, C. Yamashita and T. Ishikawa: Proc. SPIE 3773, 21 (1999).
- 20) SPring-8 挿入光源ハンドブック '96, p. 245.
- 21) H. Maruyama, M. Suzuki, N. Kawamura, M. Ito, E. Arakawa, J. Kokubun, K. Hirano, K. Horie, S. Uemura, K. Hagiwara, M. Mizumaki, S. Goto, H. Kitamura, K. Namikawa and T. Ishikawa: J. Synchrotron Rad. 6, 1133 (1999).
- 22) K. Sakurai, S. Uehara and S. Goto: J. Synchrotron Rad. 5, 554 (1998).
- 23) 伊藤正久:私信.
- 24) 鈴木基寛,河村直己,石川哲也:日本物理学会1999年秋の 分科会26pYA-1(岩手大学,1999年9月24日~27日).
- 25) 早川慎二郎, 宇賀神邦裕, 佐々木功, 宮村一夫, 合志陽 ー:X線分析の進歩 29,233 (1998).

- 26) N. Kawamura, H. Maruyama, K. Kobayashi, S. Uemura, A. Urata and H. Yamazaki: J. Phys. Soc. Jpn. 68, 923 (1999).
- 27) T. Iwazumi, A. Koyama, Y. Sakurai: Rev. Sci. Instrum. 66, 1691 (1995).
- 28) N. Kawamura, H. Maruyama, K. Kobayashi, I. Inoue and H.

Yamazaki: J. Phys. IV France 7, C1, 269 (1997).

- 29) A. Koizumi, M. Takagaki, M. Suzuki, N. Kawamura and N. Sakai: submitted to Phys. Rev. Letter.
- 30) 沖津康平,上ヱ地義徳,佐藤公法,雨宮慶幸:東京大学工 学部総合試験所年報 58,231 (1999).